

Установка плазменной обработки CIONE6-ICP-ЗМР

Image not found or type unknown



Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Камера

Прямоугольная алюминиевая камера с
дверцей 200×220×160 мм

Объем камеры	7 л.
Газовая система	Цифровые РРГ
Генератор плазмы	Генератор для источника ICP с автоматическим согласованием, Генератор Bias электрода
Режимы работы	Только ICP: очистка, модификация поверхности, плазмохимическое травление, Только Bias: реактивное ионное травление низкой плотности (мягкое травление, ICP + Bias: плазменное травление высокой плотности
Управление	Автоматическое (сенсорный дисплей)
Держатель образцов	Лоток для образцов диаметром 6 дюймов
Датчик давления	Пирани
Вакуумный насос	Безмасляный насос

Описание

Серия **CIONE-ICP** с уникальной конструкцией источника индуктивно-связанной плазмы планарного типа обеспечивает более высокую плотность и неповреждающую плазму, а также обеспечивает высокую производительность направленного травления в сочетании с электродом смещения.

С помощью этого оборудования пользователи могут выборочно выполнять **травление высокой плотности** наряду с удалением нанослоев, называемое «**мягким травлением**», а также модификацию поверхности, такую как придание **гидрофильности, активацию поверхности, очистку и улучшение адгезии. Области применения:**

- Групповая обработка объемных образцов: электроника, приборостроение, медицина и др.;
- Керамика 60×48 мм (групповая обработка): очистка перед напылением, микросваркой; удаление остатков ФР;
- Полупроводниковые пластины до 8" (групповая обработка): очистка перед напылением, микросваркой; удаление остатков ФР.
- Подготовка корпусов электронных изделий перед клейкой и разваркой компонентов.
- Обработка печатных плат перед нанесением паяльной пасты;

- Очистка заготовок печатных плат после операций резки и пробивки отверстий;
- Обработка печатных плат перед монтажом навесных элементов;
- Обработка печатных плат перед нанесением адгезива или компаунда.